科学研究費助成事業

平成 2 8 年 6 月 1 3 日現在

研究成果報告書

機関番号: 14301 研究種目: 基盤研究(A)(一般) 研究期間: 2011~2015

課題番号:23246131

研究課題名(和文)太陽電池用シリコン製造法のイノベーション

研究課題名(英文)Innovation in Production Method of Solar Silicon

研究代表者

野平 俊之(Nohira, Toshiyuki)

京都大学・エネルギー理工学研究所・教授

研究者番号:00303876

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 36,300,000円

研究成果の概要(和文):溶融塩として主にCaCl2(850)を使用し、シリカ電解還元による低リン・低ホウ素シリコン 製造法の開発を行った。高純度化検討については、得られたシリコン中の不純物濃度をICP-MSおよびGD-Mにより分析し た。その結果、ホウ素については0.5 ppm以下、リンについては0.4 ppm以下を達成した。連続化プロセスの検討として 、カソードに液体Zn-Si系を用いる検討を行った。SEM/EDX分析により、シリカからシリコンへの還元を確認した。さら に、液体Zn-Si合金からのSi回収についても初期検討を行い、結晶性Siの回収に成功した。

研究成果の概要(英文):We developed the new production process of silicon with low concentrations of boron and phosphorous by the electrochemical reduction of silica in molten CaCl2 at 1123 K. The lowest impurity level of the obtained silicon was confirmed to be B < 0.5 ppm and P < 0.4 ppm by ICP-MS and GD-MS. Aiming at the development of a continuous production method, we investigated the electrochemical reduction of silica on a liquid zinc cathode in molten CaCl2 at 1123 K. By SEM/EDX analysis, silica powder was confirmed to be reduced to silicon. Moreover, we succeeded in the recovery of silicon from the liquid Zn-Si alloy.

研究分野: 電気化学、溶融塩

キーワード: 太陽電池用シリコン シリカ 溶融塩電解 低リン 低ホウ素 連続プロセス



1.研究開始当初の背景

(1) 50年後さらには100年後を見据えて エネルギー・環境問題を考えた場合、化石エ ネルギーに代わり再生可能エネルギーを大 幅導入する必要があることは論をまたない。 中でも全世界のエネルギー需要に応え得る ポテンシャルを有するのは、太陽光と風力と 言われている。特に太陽電池技術は今後益々 重要となる。太陽電池の中でも結晶系(単結 晶・多結晶)シリコン太陽電池は、高変換効 率・高耐久性といった特長から、本研究開始 当時の全太陽電池生産量の8割以上を占めて いた。さらに、無害、豊富な資源量といった 観点から、世界的超大量生産に対応可能な太 陽電池材料の最有力候補である。

(2) 一方、最大の課題は、原料となる太陽電 池級シリコン(SOG-Si、純度 6N-7N)の製造コ ストであった。現行法では、シリカの炭素熱 還元で得られる金属級シリコン(99%)をシラ ンガスへ変換し、蒸留精製した後に再びシリ コンへ還元させており、エネルギーコストお よび製造コストが高い。従って、今後の大量 需要に応えるためにはシリカの還元方法か ら抜本的に見直す「太陽電池用シリコン製造 法のイノベーション」が必要である。

(3) 本研究代表者は、高温溶融塩系における 電気化学的研究を行っている過程で、固体中 から様々な元素を選択的に除去可能である ことに気付いた。そして、SiO2に Mo 等の金 属電極を接触さて「電子伝導体/SiO₂/溶融塩」 の三相界面を確保する「SiO₂接触型電極」を 新たに考案し、この新電極を用いて 850 の 溶融 CaCl2 中において、高純度 SiO2(石英板、 15 x 5 x 1 mm)がほぼ完全に Si に還元される ことを世界で初めて示した[]。この研究過 程では、生成するシリコンが柱状で直径数ミ クロンから数十ミクロンの双晶であること []、電解還元によりリンおよびホウ素不純 物濃度が増加しないことなどを明らかにし た。また、ビーカースケールではあるものの、 電解還元シリコンを加熱融解させることに よりインゴット化することにも成功してい S[]。

2.研究の目的 (1)本研究では、上記のような研究実績があ る溶融 CaCl2中における固体シリカ直接電解 還元法について、「高純度化」および「プロ セスの連続化」の観点から研究を発展させる ことを目的とした。

(2) 高純度化については、高純度シリカとシ リコンの混合粉末をペレット状に成型した 後に電解還元する方法において、ペレットの 準備方法、溶融塩の高純度化、装置材料の最 適化、電解条件の最適化等を行う。これによ り、生成シリコン中の不純物濃度として、 B<0.1 ppm、P<0.2 ppm を目標とする。この純 度が達成されると、一度の一方向性凝固精製 により他の金属不純物は除去可能であり、太 陽電池用シリコンが製造できる。

(3) プロセスの連続化については、シリコン は電解操作温度では固体であるが、ペレット 成分やサイズの検討、カソード材料の変更、 電解セル形状や電解方式の工夫により生成 シリコンをスラリーもしくは液体合金とし て連続的に取り出す方法を開発する。

3.研究の方法

(1) 従来の電解方式および電解セル(内径約) 10 cm、溶融塩量 300 ml、SiO₂量数 g)でのさ らなる高純度化を追求した。溶融塩には CaCl₂を用いた。安価に精製された高純度シ リカ(B<0.05 ppm, P<0.05 ppm)とシリコンの 混合粉末をペレット状に成型した後に電解 還元する方法において、ペレットの準備方法 (成型法、焼結法等)、溶融塩の高純度化(再結 晶、予備電解、Ca 添加等)、装置材料の最適 化、電解条件の最適化等を行った。また、電 解還元サンプルの洗浄法についても、塩酸洗 浄、フッ酸洗浄、イオン交換水洗浄など種々 の方法を検討した。得られたシリコンの不純 物濃度は、おもに ICP-MS で分析した。全元 素微量分析を行いたい場合は、GD-MS によ り分析した。また、不純物混入メカニズムを 考察するために、反応途中のサンプルも準備 し分析した。ここでは適宜、XPS、SEM/EDX 等も併用した。

(2) プロセスの連続化の検討として、まず、 800-1000 においてシリコンとスラリーもし くは液体合金を形成する物質を選定し、実際 に市販の高純度シリコンと混合して溶融塩 中に浸漬させ、反応性や流動性を確認した。 その後、溶融塩や添加物質の分離・除去操作 を行い、得られたシリコンの純度を上記と同 様に ICP-MS および GD-MS で分析した。な お、分離・除去操作においては、水洗(酸、ア ルカリ、純水)だけでなく、浮遊帯溶融炉でシ リコン融点(1410)以上に昇温しての溶融凝 固も検討した。これらの結果に基づき、ペレ ット成分やサイズの検討、カソード材料の選 定、電解セル形状や電解方式の工夫により、 実際に連続的に取り出す方式を検討した。さ らにこの物質を用いた電解セルを設計・自作 し、電解還元実験を行った。

4.研究成果

(1) 不純物混入のない電解方法と後処理方法 の開発を目的とした検討を行った。まず、ペ レット形状を種々検討した結果、ペレットを 粉砕した場合でも電解還元が進行すること を見出し、不純物混入源となり得るペレット 作成工程自体を省略可能であることが分か った。また、電解還元後の試料の洗浄法とし て塩酸処理が有効であることを確認した。さ らに、電解還元後のサンプルの洗浄法として 塩酸処理に加えてフッ酸処理が有効である ことを明らかとした。洗浄後に得られたシリ コンの収率に関する検討から、電解還元時の 還元率を高くすると収率が向上することも 分かった。本研究期間中に得られたシリコン について、GD-MS 分析による最も少ない不 純物量は、B=0.47 ppm、P=0.39 ppm であった。 これらは、目標値である B<0.1 ppm、P<0.2 ppm には届かなかったが、今後の研究開発に より達成できる可能性を示す値である。

(2) 高純度シリカの電解還元プロセスについ て、これまでに粒状シリカの粒径によって還 元速度が変化することが分かっていたが、そ の反応メカニズムについては不明な点も多 かった。この点を解析するため、小型黒鉛ル ツボの内壁をアルミナ管で遮断し底面のみ 露出させた構造の電極を準備し、その内部に 粒径 0.10-0.25 mm および 1-2 mm のシリカを 充填して 850 の溶融 CaCl₂ 中において電解 還元を行った(図 1)。



Graphite crucible



電解後のルツボの断面観察の結果(図2)、ルツ ボ底面近傍の粒子から遠方の粒子へ還元が 順に進行する様子が観察され、粒子表面の還 元は速く、粒子内部への還元は遅いことが明 らかとなった。



図 2. 小型ルツボ電極による電解還元後のサ ンプル断面 .粒径:(a) <0.1 mm、(b) 0.5-1.0 mm. 電解時間:(I) 20 分、(II) 60 分. (3) プロセスの高純度化を目的として、高純 度シリコンルツボを使用した電解還元法も 開発した。さらに、電解還元で得られたシリ コン粒を原料として、浮遊帯溶融法により結 晶 Si 棒の形成にも成功した(図 3)。



図 3. 電解還元で得られたシリコン粉末を用 いて浮遊帯溶融法により作製されたシリコ ンインゴット.

(4) 図 4 にラボスケールでの連続電解プロセ ス用の電解セルを示す。作用極に Pt リード線 と接続した Si るつぼ(外径 100×内径 90×高 さ 150 mm)を用いた。上部からるつぼ内に粉 末状 SiO₂を投入した後、作用極を 0.6 V vs. Ca²⁺/Ca で 30 時間の定電位電解を行った。電 解後、底部に留まった生成 Si を、溶融 CaCl₂ と共にセル底部から吸い上げで抜き取った。 原料投入 電解還元 生成物回収 原料投 入のように連続して操作を行った。



図 4. ラボスケールでの連続電解プロセス実 験装置.

図 5 (a)に、ラボスケールでの連続電解実験後 のシリコンルツボ底部の写真を示す。茶褐色 のシリコンが底部にスラッジのように貯ま っていることが確認された。図 5 (b) に、底 部から吸い上げたシリコンを示す。洗浄後に 粉末 XRD を行った結果、結晶性シリコンで あることが明らかとなった。これらの結果よ り、溶融電電解によるシリコンの連続生産の 可能性を実証することができた。



Si crucible

図 5. 連続電解実験後の写真.(a) 大部分の溶 融塩を除去後にルツボ上部から見た様子.(b) 溶融塩とともに吸い上げられた粉末シリコン.

(5) これまで検討してきた方法では、セル底 部の陰極で生成する Si が粉末状であるため、 電解セルからの効率的な回収が課題となる。 また、CaCl₂ との分離に水や酸による溶解処 理が必要という課題もある。そこで、溶融塩 からの分離回収等を効果的に行う手法とし て、底部陰極に Si-Zn 液体合金を用いる電解 プロセスを考案した[]。本プロセスの概念 図を図 6 に示す。



図 6. 溶融 CaCl₂ と液体 Si-Zn 合金カソードを 用いた新規な太陽電池級シリコン製造プロ セスの概念図.

プロセスは、(1)SiO₂から Si-Zn 液体合金を生 成する電解工程、(2)降温により Si-Zn 液体合 金から Si の一部を析出させて回収する分離 工程、(3)一方向凝固や残留 Zn の揮発除去を 行う精製工程、から構成される。分離工程後 に Si 濃度の下がった Si-Zn 液体合金は、電解 工程の陰極として再び使用される。本研究で は、本プロセスの要素技術として、固体 Si と液体 Zn との合金化速度、液体 Zn 電極上で の SiO₂の電解還元、ならびに Si-Zn 液体合金 からの Si の析出について検討を行った。

(6) 1123 K に保持した液体 Zn 中へ、単結晶 Si 板(約 6 mm × 35 mm、厚さ 5 mm)を 2 秒~ 60 秒浸漬し、浸漬後の Si 板厚みを測定する ことで Si と Zn の合金化速度を求めた。図 7 に、Si 板片面あたりにおける厚みの減少値の 浸漬時間依存性を示す。浸漬時間に比例して 厚みが減少しており、合金化速度は 4.45 μm/s であった。同様の実験を液体合金中の Si 濃度 を変化させて行ったところ、図 8 に示すよう に、合金化速度は Si 濃度に対して直線的に小 さくなり、外挿から求められる合金化速度ゼ ロとなる濃度は Si-Zn 系状態図[]の液相線 組成(6.0 mol%)とほぼ等しくなった。



図 7.1123 K の液体 Zn へ Si 板を浸漬させた際 の Si 板片面あたりの板厚減少値の浸漬時間 依存性.



図 8.1123 K において Si 板が Zn と合金化する

図 8. 1123 K において Si 板が Zn と合金化する 速度の液体 Si-Zn 合金中 Si 濃度依存性 .

これらの結果から、固体 Si と液体 Zn との合 金化反応は、液相中における Si もしくは Zn の拡散が律速過程であると考えられる。筆者 らのこれまでの研究により、SiO2電解の初期 300 秒間における Si 生成速度は、SiO2の表面 方向で 2.1 μ m/s[]、内部方向で 0.27 μ m/s[] であることが分かっている。Si と Zn との合 金化速度はこれらの値より大きく、SiO2を Zn 上で電解した場合に、Si と Zn との合金化反 応が律速となることはないと考えられる。

(7) Zn 電極を用いたサイクリックボルタンメ トリーの結果をもとに、Zn に対して 5.6 at% 相当の SiO₂ 粉末をアルミナ保護管上部から 投入し、液体 Zn 上部に SiO₂が接触した状態 として、0.9 V(vs. Ca²⁺/Ca)において 5.5 時間の 定電位電解を行った。電解後に急冷した Zn 電極の、断面写真と断面 SEM 像を図 9 に示 す。粒径 1 μm 程度の微細な粒子が、Zn マト リックス中に析出しているのが確認された。 粒子を EDX で分析したところ、代表的な粒 子の組成は 57Si-31Zn-6O-4Cl- 2Ca(at%)であ った。Si-Zn 系状態図[]]によると、1123 K では液体 Zn 中への Si の溶解度は 6.0 at%であ るが、常温では Zn と Si にはほとんど溶解度 がない。そのため、液体 Zn の上部において SiO2 の電解還元が起こり、液体 Zn 中に溶解 した Si 成分が、冷却時に相分離したものと考 えられる。



図 9.1123 K の溶融 CaCl₂ 中において Zn カソ ード上で SiO₂ 粉末を電解還元した後の電極 の様子. 左図:断面写真. 右図: SEM 像.

(8) 上述の結果を踏まえ、実際に液体 Si-Zn 合金から固体 Si を析出させた。まず、アルミ ナるつぼ内で事前に真空乾燥させた CaClyを 1123 KのAr雰囲気下で溶融させた。次に、 カーボン管を浴に挿入し、そこから Zn、金属 級 Si (純度 2N)の順に投入して液体 4.5at%Si-Zn 合金を生成させた。その後、1123 K から 20 時間かけて 723 K まで炉冷し、そこで 5 時 間保持した後、さらに 20 時間かけて室温ま で炉冷することで、Zn マトリックス中に固体 Si 粒が析出した合金塊を得た。続いて合金塊 を切断し、一部について断面 SEM 観察およ び EDX 分析を行った。図 10 にその合金塊の 断面写真および SEM 像を示す。この結果よ り、Znマトリックス中にSi 結晶が析出して いることが分かった。



図 10. 液体 Si-Zn 合金からの析出により生成 したシリコン結晶の SEM 像.

次に、硝酸で Zn を溶解させて析出 Si を回収 した。析出 Si は超純水で洗浄した後、GD-MS による不純物濃度分析を行った。B、P、O、 C、Al、Ca、Fe、Ti および Zn の各元素につ いて、投入した金属級 Si および実験で得られ た析出 Si 中の不純物濃度を比較した。その結 果、特に金属元素について不純物が効果的に 除去されることが分かった。

< 引用文献 >

<u>T. Nohira</u>, K. Yasuda and Y. Ito, Pinpoint and bulk electrochemical reduction of insulating silicon dioxide to silicon, Nature Materials, Vol. 2, pp. 397-401 (2003).

K. Yasuda, T. Nohira, K. Amezawa, Y. H.

Ogata and Y. Ito, Mechanism of Direct Electrolytic Reduction of Solid SiO_2 to Si in Molten CaCl₂, J. Electrochem. Soc., Vol. 152, No. 4, pp. D69-D74 (2005).

K. Yasuda, <u>T. Nohira</u>, R. Hagiwara and Y. H. Ogata, Direct electrolytic reduction of solid SiO_2 in molten $CaCl_2$ for the production of solar grade silicon, Electrochimica Acta, Vol. 53, pp. 106-110 (2007).

安田幸司, <u>野平俊之</u>, 萩原理加, 本間敬 之, 第 45 回溶融塩化学討論会要旨集, p.49-50 (2013).

R.W. Olesinski and G. J. Abbaschian, Bulletin of Alloy Phase Diagrams, Vol. 6, pp. 6 (1985).

K. Yasuda, T. Nohira, K. Takahashi, R. Hagiwara and Y. H. Ogata, J. Electrochem. Soc., <u>152</u>, D232 (2005).

K. Yasuda, T. Nohira and Y. Ito, J. Phys. Chem. Solids, <u>66</u>, 443, (2005).

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計8件)

X. Yang, K. Yasuda, <u>T. Nohira</u>, R. Hagiwara, T. Homma, Cathodic potential dependence of electrochemical reduction of SiO₂ granules in molten CaCl₂, Metallurgical and Materials Transactions E, 查読有, published online (2016).

DOI: 10.1007/s40553-016-0081-1

X. Yang, K. Yasuda, <u>T. Nohira</u>, R. Hagiwara, T. Homma, The Role of Granule Size on the Kinetics of Electrochemical Reduction of SiO₂ Granules in Molten CaCl₂, Metallurgical and Materials Transactions B, 査読有, Vol. 47, No. 1, pp. 788-797 (2016). DOI: 10.1007/s11663-015-0456-1

X. Yang, K. Yasuda, <u>T. Nohira</u>, R. Hagiwara, T. Homma, Kinetic Characteristics of Electrochemical Reduction of SiO₂ Granules in Molten CaCl₂, J. Electrochem. Soc., 查読 有, Vol. 161, No. 7, pp. D3116-D3119 (2014).

DOI:10.1149/2.017407jes

X. Yang, K. Yasuda, <u>T. Nohira</u>, R. Hagiwara, T. Homma, Reaction Behavior of Stratified SiO₂ Granules during Electrochemical Reduction in Molten CaCl₂, Metallurgical and Materials Transactions B, 查読有, Vol. 45B, pp.1337-1344 (2014).

DOI:10.1007/s11663-014-0056-5

T. Toba, K. Yasuda, <u>T. Nohira</u>, X. Yang, R. Hagiwara, K. Ichitsubo, K. Masuda and T. Homma, Electrolytic Reduction of SiO₂ Granules in Molten CaCl₂, Electrochemistry, 査読有, Vol. 81, No. 7, pp. 559-565 (2013). DOI:10.5796/electrochemistry.81.559

T. Toba, K. Yasuda, <u>T Nohira</u>, R. Hagiwara, K. Ichitsubo, K. Masuda and T. Homma, Fundamental Study on Reduction Rate for

Electrolytic Reduction of SiO₂ Powder in Molten CaCl₂, ECS Transactions, 查読無, 50(11), 119-126 (2012). DOI:10.1149/05011.0119ecst <u>野平俊之</u>、溶融 CaCl₂ 中におけるシリカ の電解還元、Electrochemistry、査読無、 79巻、2011、893-897. 野平俊之、溶融塩中におけるシリカから シリコンへ直接電解還元、溶融塩および 高温化学、查読無、54巻、2011、95-103. [学会発表](計28件) 安田幸司、島尾武征、楊肖、野平俊之 萩原理加、一坪幸輝、増田賢太、本間敬 之、液体 Zn との合金化反応を利用した溶 融 CaCl2中における SiO2電解還元プロセ スの開発、第38回電解技術討論会、埼玉 大学、2014年11月13-14日 楊肖、安田幸司、<u>野平俊之</u>、萩原理加、 -坪幸輝、増田賢太、本間敬之、溶融 CaCl2 中における粉末状 SiO2 電解還元の反応機 構と速度解析、第38回電解技術討論会、 埼玉大学、2014年11月13-14日 楊肖、安田幸司、野平俊之、萩原理加、 一坪幸輝、増田賢太、本間敬之、溶融 CaCl 中における粉末状 SiO2 電解還元の反応機 構と反応速度論的解析、資源・素材学会 平成 26 年度秋季大会、熊本大学、2014 年9月15-17日 楊肖、安田幸司、<u>野平俊之</u>、萩原理加、 -坪幸輝、増田賢太、本間敬之、溶融 CaClっ 中での粉末状 SiO₂の直接電解還元、電気 化学会第81回大会、 関西大学、 2014年3 月 29-31 日 Xiao Yang, Kouji Yasuda, Toshiyuki Nohira, Rika Hagiwara, Koki Ichitsubo, Kenta, Masuda, Takayuki Homma, Direct Electrochemical Reduction of SiO₂ Granules in Molten CaCl₂, 7th KIFEE International Symposium on Environment, Energy and Materials, Kambaikan, Doshisha University, Kyoto, Japan March 16-19, 2014. 野平俊之、溶融塩電解によるシリコン製造、 電解科学技術委員会第92回委員会、電気 化学会会議室、東京、2014年2月4日 安田幸司、野平俊之、萩原理加、本間敬 之、溶融 CaCl₂中における SiO₂電解への 液体 Si-Zn 合金陰極の使用に関する検討、 第 45 回溶融塩化学討論会、慶應義塾大学 日吉キャンパス、2013年11月20-21日 島尾武征、楊肖、安田幸司、野平俊之、 萩原理加、一坪幸輝、増田賢太、本間敬 之、溶融 CaClo 中における液体亜鉛電極 の電気化学的挙動、第45回溶融塩化学討 論会、慶應義塾大学日吉キャンパス、2013 年11月20-21日 楊肖、安田幸司、<u>野平俊之</u>、萩原理加、 一坪幸輝、増田賢太、本間敬之、溶融 CaCl₂ 中における粉末状 SiO2 電解還元機構の解

明、第37回電解技術討論会、大阪府立大

学 I-site なんば、2013 年 11 月 14-15 日 野平俊之、新たな太陽電池用シリコン製 造法を目指して:溶融塩中におけるシリ カの直接電解還元、第2回 SPERC スマー トエネルギー工学講演会、岩手大学、2013 年4月1日 鳥羽哲也、安田幸司、<u>野平俊之</u>、萩原理 加、一坪幸輝、増田賢太、本間敬之、溶 融 CaCl,中における粉末状 SiO,電解還元 に関するプロセス検討、第36回電解技術 討論会、滋賀県立大学、平成 24 年 10 月 26日. Tetsuya Toba, Kouji Yasuda, Toshiyuki Nohira, Rika Hagiwara, Koki Ichitsubo. Kenta Masuda and Takayuki Homma, "Fundamental Study on Reduction Rate for Electrolytic Reduction of SiO₂ Powder in Molten CaCl₂", The 222nd Meeting of the Electrochemical Society, Honolulu, Hawaii, 2012.10.8. 鳥羽哲也、小林克敏、安田幸司、<u>野平俊</u> 之、萩原理加、一坪幸輝、増田賢太、本 間敬之、溶融 CaCl₂中での粉末状 SiO₂の 電解還元における還元速度向上の検討、 電気化学会第 79 回大会、2012/3/31、浜松. T.Nohira, T.Toba, K.Kobayashi, K.Yasuda, R.Hagiwara, K. Ichitsubo, K.Masuda, Electrolytic Reduction of High-purity SiO₂ in Molten CaCl₂ for the Production of Solar Silicon, ECO-MATES2011, 2011/11/29, Osaka, Japan. 鳥羽哲也、小林克敏、安田幸司、<u>野平俊</u> 之、萩原理加、一坪幸輝、増田賢太、溶 融 CaCl2中における SiO2ペレットの電解 還元、第 43 回溶融塩化学討論会、 2011/11/22、大阪. <u>野平俊之</u>、溶融塩中におけるシリカから シリコンへ直接電解還元、第176回溶融 塩委員会、2011/10/21、同志社大学京田辺 キャンパス. T.Nohira, T.Toba, K.Kobayashi, K.Yasuda, R.Hagiwara, K.Yamada, K.Miura, Production of Solar-Grade Si from High-Purity SiO₂, 220th ECS Meeting, 2011/10/10, Boston, USA. T.Nohira, K.Kobayashi, T.Toba, R.Hagiwara, K.Ichitsubo, K. Yamada, Electrolytic Reduction of High-purity SiO₂ in Molten CaCl₂ for the Production of Solar Silicon, 9th International Symposium on Molten Salts Chemistry & Technology, 2011/6/9, Trondheim, Norway.

6 . 研究組織

(1)研究代表者
野平 俊之(NOHIRA, Toshiyuki)
京都大学・エネルギー理工学研究所・教授
研究者番号: 00303876